PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-235449

(43) Date of publication of application: 09.09.1997

(51)Int.Cl.

CO8L 63/00 CO8G 59/24 CO8K 3/00 CO8K 5/521 H01L 23/29 H01L 23/31

(21)Application number: 08-344716

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

25.12.1996

(72)Inventor: SHIMIZU TAKESHI

TOKUNAGA ATSUTO TANAKA MASAYUKI

(30)Priority

Priority number : **07343947**

Priority date : 28.12.1995

Priority country: JP

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an epoxy resin composition improved in flame retardancy, hightemperature reliability, soldering-heat resistance, package filling properties and reliability of humidity resistance by mixing an epoxy resin with a curing agent, a specified amount of an inorganic filler and a phosphoric ester compound.

SOLUTION: This composition is prepared by melt-mixing 0.05-15wt.% epoxy resin (A) essentially consisting of a biphenyl type epoxy component having a structure represented by formula I (wherein R1 to R8 are each H, a 1-4 C alkyl or a halogen) with a curing agent (B) which cures component A, is represented by formula II (wherein m is 0 or greater; X is an aromatic group; Y is a monovalent or bivalent aromatic group having a phenol group) and is used in such an amount that the chemical equivalent ratio of the curing functional groups of component B to the epoxy groups of component A is 0.5-1.5, 85-98wt.%, based on the resin composition,

$$A = CH^{-1}X + CH^{-1}X + CH^{-1}X + CH^{-1}X$$

II

III

inorganic filler (C) (e.g. amorphous silica), 0.01-10wt.% (in terms of the phosphorus atoms), based on the components except component C, phosphoric ester compound (C) having a structure represented by formula III (wherein X is an at least monovalent aromatic group) in the molecule and an ion-trapping agent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of

- 3			7.
•			
ė.		;	

rejection]

[Kind of final disposal of application other than withdrawal the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

22.09.2004

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-235449

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
C08L 63/00	NHQ		C08L	63/00		NHQ	
C 0 8 G 59/24			C08G	59/24			
C 0 8 K 3/00	NKT		C08K	3/00		NKT	
5/521	NLB			5/521		NLB	
H01L 23/29			H01L	23/30		R	
		審査請求	未請求 請求	関の数17	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-344716		(71)出願/	000003 1	159		
				東レ株	式会社		
(22)出顧日	平成8年(1996)12月	25日				日本橋室町2-	丁目2番1号
			(72)発明者				
(31)優先権主張番号	特願平7-343947	·		愛知県	名古屋i	市港区大江町 :	9番地の1 東
(32)優先日	平7 (1995)12月28日					古屋事業場内	
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者				
				爱知果	名古屋	市港区大江町 9	9番地の1 東
				レ株式会	会社名	古屋事業場内	
			(72)発明者	新田中 ī	E幸		
					占古屋i	市港区大江町 9	9番地の1 東
						古屋事業場内	

(54)【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】ハロゲン系難燃剤、アンチモン系難燃剤を必ず しも使用することなく、難燃性、成形性、信頼性および 半田耐熱性に優れた半導体封止用エポキシ樹脂組成物を 提供すること。

【解決手段】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)を含有し、無機質充填剤(C)の含有量が組成物に対して80重量%以上であるエポキシ樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機 質充填剤(C)およびリン酸エステル化合物(D)を含 有し、無機質充填剤(C)の含有量が組成物に対して8 ○重量%以上であるエポキシ樹脂組成物。

【請求項2】エポキシ樹脂組成物中の、エポキシ樹脂 (A)の割合が0.05~15重量%、硬化剤(B)の 割合が、(A)成分のエポキシ基に対する(B)成分の 硬化性官能基の化学当量比が0.5~1.5となる量、 リン酸エステル化合物(D)の割合が、それが有するリ ン原子が、無機質充填剤を除く成分の0.01~10重 量%となる量である請求項1記載のエポキシ樹脂組成 物。

【請求項3】リン酸エステル化合物のリン原子が5価の ものである請求項1または2記載のエポキシ樹脂組成 物。

【請求項4】リン酸エステル化合物が、芳香族基を有す るものである請求項1~3いずれかに記載のエポキシ樹 脂組成物。

【請求項5】リン酸エステル化合物(D)が下記化学式*20

*(I)の構造を分子中に有するものである請求項1~4 いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【化1】

$$\begin{array}{c} X \\ O \\ O \\ X \end{array} \qquad (I)$$

(式 I 中、Xは同一でも異なっていてもよく、1 価以上 の芳香族基を意味する。)

【請求項6】エポキシ樹脂組成物がイオン捕捉剤を含有 するものである請求項1~5いずれかに記載のエポキシ 樹脂組成物。

【請求項7】イオン捕捉剤がハイドロタルサイト系化合 物である請求項6記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項8】エポキシ樹脂(A)が下記化学式(II)の 構造を有するビフェニル型エポキシ成分を必須成分とす る請求項1~7いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【化2】

$$CH_2 - CHCH_2 - O - R_2 R_3 R_6 R_8$$

$$CH_2 - CHCH_2 - O - CH_2 CH - CH_2$$

$$\cdots (II)$$

(ただし、式中のR1~R8は、水素原子、炭素数1~ 4のアルキル基またはハロゲン原子を示す)

【請求項9】硬化剤が下式に示されるフェノール化合物※

$$%$$
 (VI)を必須成分とする請求項 $1 \sim 8$ いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【化3】

$$Y - C H_2 - X - C H_2 - (Y - C H_2 - X - C H_2)_m Y$$
 ... (VI)

(式III においてmはO以上の整数、Xは同一でも異な っていてもよく、2価の芳香族基、Yは同一でも異なっ ていてもよく、フェノール基を有する1価または2価の 芳香族基。

【請求項10】さらにリン酸エステル化合物の50重量 %以上が分子量300以上のものである請求項1~9い ずれかに記載のエボキシ樹脂組成物。

【請求項11】無機質充填剤(C)の含有量が、樹脂組 成物の85~98重量%であることを特徴とする請求項 1~10いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項12】硬化後の組成物の酸素指数が42%以上 である請求項1~11いずれかに記載のエポキシ樹脂組 成物。

【請求項13】半導体封止用である請求項1~12いず れかのエポキシ樹脂組成物。

【請求項14】請求項13に記載のエポキシ樹脂組成物 で、半導体素子が封止された半導体装置。

【請求項15】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無 機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)を溶融 混合することを特徴とするエポキシ樹脂組成物の製造方 50 を用いた封止方法が中心になっている。近年の半導体装

法。(ただし無機質充填剤(C)の配合量が組成物に対 して80重量%以上である)

【請求項16】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無 機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)および イオン捕捉剤を溶融混合することを特徴とするエポキシ 樹脂組成物の製造方法。(ただし無機質充填剤(C)の 配合量が組成物に対して80重量%以上である)

【請求項17】イオン捕捉剤がハイドロタルサイト系化 合物である請求項16記載のエポキシ樹脂組成物の製造 40 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、難燃性、髙温信頼 性および半田耐熱性に優れるエポキシ樹脂組成物、詳し くは半導体封止用エポキシ樹脂組成物および半導体装置 に関するものである。

【0002】半導体装置などの電子回路部分の封止方法 としては、経済性、生産性、物性のバランスの点からエ ポキシ樹脂、硬化剤、無機質充填剤からなる封止用樹脂

置の薄型・高密度化により、半導体装置に対する半田耐 熱性・高温信頼性・耐湿信頼性などの要求は高まってお り、それに従って封止用樹脂への要求もより高まってい る。

【0003】これら半導体装置などの電子部品には安全 性確保のために、UL規格により難燃性の付与が義務づ けられている。このため、これまで封止用樹脂には、難 燃剤として臭素化エポキシ樹脂などのハロゲン化物系難 燃剤が、また難燃助剤として三酸化アンチモンなどのア ンチモン化合物が添加されていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】近年、環境問題に対す る意識が高まってきており、半導体封止用樹脂に難燃剤 として使用される種々の化合物に対しても課題が指摘さ れている。

【0005】一方、ハロゲン化物難燃剤が配合されたエ ポキシ樹脂組成物で封止された半導体装置を高温環境に おいた場合に、半導体装置の信頼性が低下するという問 題があった。

【0006】またアンチモン化合物を含有させた場合、 樹脂の廃棄物の処理の手間が憂慮されている。

【0007】さらに半導体装置の半田耐熱性および高温 信頼性、また半導体素子を封止する際のパッケージ充填 性に対して、さらなる改良が要望されていた。

【0008】本発明は、従来の難燃剤であるハロゲン化 物系難燃剤、アンチモン化合物を必ずしも使用しなくと も難燃性、高温信頼性、半田耐熱性、パッケージ充填性 に代表される成形性に優れたエポキシ樹脂組成物の提供 を課題とするものであり、さらに耐湿信頼性が要求され る場合には、その特性を向上させるエポキシ樹脂組成物 30 (8) エポキシ樹脂(A)が下記化学式(II)の構造 の提供を課題ともするものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、

(1) エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充 填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)を含有し、無米 *機質充填剤(C)の含有量が組成物に対して80重量% 以上であるエポキシ樹脂組成物、(2)エポキシ樹脂組 成物中の、エポキシ樹脂(A)の割合が0.05~15 重量%、硬化剤(B)の割合が、(A)成分のエポキシ 基に対する(B)成分の硬化性官能基の化学当量比が 0.5~1.5となる量、リン酸エステル化合物 (D) の割合が、それが有するリン原子が、無機質充填剤を除 く成分の0.01~10重量%となる量である前記

(1)記載のエポキシ樹脂組成物、(3)リン酸エステ 10 ル化合物のリン原子が5価のものである前記(1)また は(2)記載のエポキシ樹脂組成物、(4)リン酸エス テル化合物が、芳香族基を有するものである前記(1) ~(3)いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物、(5) リン酸エステル化合物(D)が下記化学式(I)の構造 を分子中に有するものである請求項1~4いずれかに記 載のエポキシ樹脂組成物、

【化4】

$$X - O - P - O - X \tag{I}$$

(式中、Xは同一でも異なっていてもよく、1価以上の 芳香族基を意味する。)

(6) エポキシ樹脂組成物がイオン捕捉剤を含有するも のである前記(1)~(5)いずれかに記載のエポキシ 樹脂組成物、(7)イオン捕捉剤がハイドロタルサイト 系化合物である前記(6)記載のエポキシ樹脂組成物、

を有するビフェニル型エポキシ成分を必須成分とする前 記(1)~(7)いずれかに記載のエポキシ樹脂組成 物。

[0010]

【化5】

$$CH_2 - CHCH_2 - O - CH_2 - C$$

(ただし、式中のR1~R8は、水素原子、炭素数1~ ※ポキシ樹脂組成物。 4のアルキル基またはハロゲン原子を示す)

(9)硬化剤が下式に示されるフェノール化合物(VI)を 必須成分とする前記(1)~(8)いずれかに記載のエ※

[0011]

【化6】

$$Y - C H_2 - X - C H_2 - (Y - C H_2 - X - C H_2)_m Y \cdots (YI)$$

(式VI においてmはO以上の整数、Xは同一でも異な っていてもよい2価の芳香族基、Yは同一でも異なって いてもよく、フェノール基を有する1価または2価の芳 香族基)、(10)リン酸エステル化合物の50重量% 50 8重量%であることを特徴とする前記(1)~(10)

以上が分子量300以上のものである前記(1)~ (9)いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物、(11) 無機質充填剤(C)の含有量が、樹脂組成物の85~9

いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【0012】(12)硬化後の組成物の酸素指数が42 %以上である前記(1)~(11)いずれかに記載のエ ポキシ樹脂組成物、(13) 半導体封止用である前記 (1)~(12)いずれかのエポキシ樹脂組成物、(1 4) 前記(13) に記載のエポキシ樹脂組成物で、半導 体素子が封止された半導体装置、および製造方法の発明 として、(15)エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、 無機質充填剤(C)、リン酸エステル化合物(D)を溶 融混合することを特徴とするエポキシ樹脂組成物の製造 10 方法(ただし無機質充填剤(C)の配合量が組成物に対 して80重量%以上である)、(16)エポキシ樹脂 (A)、硬化剤(B)、無機質充填剤(C)、リン酸エ ステル化合物(D)およびイオン捕捉剤を溶融混合する ことを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物の製 造方法。(ただし無機質充填剤(C)の配合量が組成物 に対して80重量%以上である)(17)イオン捕捉剤 がハイドロタルサイト系化合物である前記(16)の半 導体封止用エポキシ樹脂組成物の製造方法、からなる。*

* [0013]

(4)

【発明の実施の形態】以下、本発明の構成を詳述する。 本発明において「重量」とは「質量」を意味する。

【0014】本発明におけるエポキシ樹脂(A)は分子 内にエポキシ基を複数個もつものならば特に限定され ず、これらの具体例としては、例えばクレゾールノボラ ック型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ 樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型 エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、線状 脂肪族エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、複素環式エ ポキシ樹脂、スピロ環含有エポキシ樹脂およびハロゲン 化エポキシ樹脂などが挙げられる。

【0015】これらのエポキシ樹脂(A)のなかで特に 本発明において好ましく使用されるものは、ハンダ耐熱 性が優れるという点で、下記一般式(II)で表される骨 格を有するビフェニル型エポキシ樹脂を必須成分として 含有するものである。

[0016]

【化7】

(ただし、式中のR1~R8は、同一でも異なっていて もよく、水素原子、炭素数1~4のアルキル基またはハ ロゲン原子を示す)。

【0017】そして、エポキシ樹脂(A)は、上記化学 式(1)で表される骨格を有するビフェニル型エポキシ 樹脂を50重量%以上、特に70重量%以上含有すると 30 とが好ましい。

【0018】上記式(I)で表されるエポキシ樹脂骨格 の好ましい具体例としては、4,4~-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)ビフェニル、4,4 -ビス (2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 3´, 5, 5´ テトラメチルビフェニル、4,4~-ビス(2,3-エ ポキシプロポキシ) - 3, 3´, 5, 5´ーテトラメチ エポキシプロポキシ) -3,3´,5,5´ーテトラメ ーエポキシプロポキシ) -3, 3´, 5, 5´ーテトラ エチルビフェニル、4,4~-ビス(2,3-エポキシ プロポキシ) -3, 3´, 5, 5´-テトラブチルビフ ェニル、4,4´ービス(2,3-エポキシプロポキ シ) ビフェニル、および4,4´ービス(2,3-エポ キシプロポキシ)-3,3´,5,5´-テトラメチル ビフェニルなどが挙げられ、それぞれ単独でも、または 混合系で用いる場合でも十分に効果を発揮する。また上※ ※記エポキシ樹脂においては、そのエポキシ基の開環によ る重合体も範囲に含まれる。

【0019】本発明において、エポキシ樹脂(A)の配 合量は、成形性および接着性の観点から、エポキシ樹脂 組成物において、通常0.05~15重量%、さらに好 ましくは2~15重量%、またさらに好ましくは2~9 重量%である。少ないと成形性や接着性が不十分になっ たり、多いと硬化物の線膨張係数が大きくなり、硬化物 の低応力化が困難となる傾向がある。

【0020】本発明における硬化剤(B)は、エポキシ 樹脂(A)と反応して硬化させるものであれば特に限定 されない。通常はフェノール性水酸基を有する化合物、 酸無水物を有する化合物、アミン類が使用され、フェノ ール性水酸基を有する化合物が好ましい。このような化 合物、すなわちフェノール性水酸基を2個以上分子内に チル-2-ブロモビフェニル、4,4~-ビス(2,3 40 有する化合物の具体例としては、たとえばフェノールノ ボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、下記式(V I) で示されるフェノールp-キシリレンコポリマー (いわゆるフェノールアラルキル樹脂)、ビスフェノー ルAやレゾルシンなどから合成される各種ノボラック樹 脂、トリス(ヒドロキシフェニル)メタン、ジヒドロビ フェニルなどの多種多価フェノール化合物、ポリビニル フェノールが例示される。

【化8】

$$Y - C H_{2} - X - C H_{2} - (Y - C H_{2} - X - C H_{2})^{m} Y \qquad \cdots \qquad (A1)$$

(式VIにおいてmは0以上の整数、Xは同一でも異なっ ていてもよい2価の芳香族基、Yは同一でも異なってい ても良く、フェノール基を有する1価または2価の芳香 族基。)

【0021】また酸無水物を有する化合物としては、無 水マレイン酸、無水フタル酸、無水ピロメリット酸など が例示される。またアミン類としてはメタフェニレンジ アミン、ジ(アミノフェニル)メタン(通称ジアミノジ フェニルメタン)、ジアミノジフェニルスルホンなどの 芳香族アミンなどが例示される。半導体封止用としては 10 耐熱性、耐湿性および保存性の点から、フェノール系硬*

* 化剤が好ましく用いられ、用途によっては2種類以上の 硬化剤を併用してもよい。

【0022】またフェノール系硬化剤としては、得られ る半導体装置の吸水性が低く半田耐熱性が優れるという 点で、下記式(III) で表される構造を有するフェノール アラルキル樹脂を含有するものであることが好ましく、 その配合量としては硬化剤の50%以上であることが好 ましい。

[0023]

【化9】

【0024】(式中のRは同一でも異なっていてもよ く、水素原子または有機基を表す。特に水素原子または 20 メチル基が好ましい。mはO以上の整数である。) 上記構造式でmが3以下の構造を90重量%以下もつも のがさらに好ましい。

【0025】本発明において、硬化剤(B)の配合量 は、樹脂組成物全体に対して通常 0.5~20重量%、 好ましくは1~10重量%、さらに好ましくは1~9重 量%である。さらには、エボキシ樹脂(A)と硬化剤 (B)の配合比は、機械的性質および耐湿信頼性の点か ら(A)のエポキシ基に対する(B)の硬化性の官能基 の化学当量比が $0.5\sim1.5$ 、特に $0.8\sim1.2$ の 30 非晶性シリカは線膨張係数を低下させる効果が大きく、 範囲にあることが好ましい。

【0026】また本発明においてエポキシ樹脂(A)と 硬化剤(B)の硬化反応を促進するために硬化触媒を用 いてもよい。硬化触媒は硬化反応を促進するものならば 特に限定されず、例えば、2-メチルイミダゾール、 2, 4-ジメチルイミダゾール、2-エチル-4-メチ ルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、2-フェ ニルー4ーメチルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミ ダゾールなどのイミダゾール化合物、トリエチルアミ ン、ベンジルジメチルアミン、αーメチルベンジルジメ 40 【0029】ととでいう平均粒子径は累積重量50%に **チルアミン、2 - (ジメチルアミノメチル) フェノー** ル、2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェ ノール、1, 8 - ジアザビシクロ(5, 4, 0)ウンデ セン-7などの三級アミン化合物、ジルコニウムテトラ メトキシド、ジルコニウムテトラプロポキシド、テトラ キス(アセチルアセト)ジルコニウム、トリ(アセチル アセト)アルミニウムなどの有機金属化合物およびトリ フェニルホスフィン、トリメチルホスフィン、トリエチ ルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリ (p-メチ

フィンなどの有機ホスフィン化合物があげられる。なか でも耐湿性の点から、有機ホスフィン化合物が好ましく 用いられる。これらの硬化触媒は、用途によっては2種 類以上を併用してもよく、その添加量は、エポキシ樹脂 (A) 100重量部に対して0.1~10重量部の範囲 が好ましい。

【0027】本発明における無機質充填剤(C)として は、非晶性シリカ、結晶性シリカ、炭酸カルシウム、炭 酸マグネシウム、アルミナ、マグネシア、クレー、タル ク、ケイ酸カルシウム、酸化チタン、酸化アンチモン、 アスベスト、ガラス繊維などがあげられるが、なかでも 低応力化に有効なため好ましく用いられる。非晶性シリ カは任意の製造方法で製造することができる。たとえば 結晶性シリカを溶融する方法、各種原料から合成する方 法などがあげられる。

【0028】本発明における非晶性シリカの形状および 粒径は特に限定されないが、平均粒径3μm以上40μ m以下の球状粒子を無機質充填剤中に60重量%以上、 さらに好ましくは90重量%以上含有することが流動性 の点から好ましい。

なる粒径(メジアン径)を意味する。本発明において無 機質充填剤の(C)の割合は難燃性、成形性および低応 力性の点から樹脂組成物全体の、好ましくは80~98 重量%、さらに好ましくは85~98重量%である。

【〇〇30】本発明の(D)成分であるリン酸エステル 化合物とは、化学構造で「P-O-R」(Rは有機基) の結合を有する化合物を言い、通常はリン原子が3価の ものまたは5価のものが使用される。3価のものとして は、ホスファイト化合物、ホスホナイト化合物、ホスフ ルフェニル)ホスフィン、トリ(ノニルフェニル)ホス 50 ィナイト化合物がある。一方5価のリン原子を有するも

のとしては、ホスフェート化合物、ホスホネート化合 物、ホスフィネート化合物がある。そのうちで5価のリ ン原子を有するリン酸エステル化合物が保存安定性およ び難燃性の観点から好ましく使用される。

【0031】さらに、これらのリン酸エステル化合物の うちエステルを形成する有機基として芳香族基を有する ものであることが難燃性、耐湿信頼性および半田耐熱性 の観点から好ましい。

【0032】このようなリン酸エステル化合物として は、トリフェニルホスフェート、レゾルシノールビス (ジフェノル) ホスフェート、2 ーエチルヘキシルジフ ェニルホスフェート、および後に説明する化合物が例示 される。

【0033】さらに、分子中に下式(I)で表される骨米

*格を含有するものであることが好ましい。

【化10】

(6)

(式中、Xは同一でも異なっていてもよく、1価以上の 10 芳香族基を意味する。)

さらに具体的には下式(IV)及び(V)で示される化合物 が示される。

[0034]

【化11】

$$\begin{pmatrix}
Ar O \\
k \\
OAr
\end{pmatrix}_{m}$$

$$\begin{pmatrix}
Ar O \\
R
\end{pmatrix}_{R}$$

$$\begin{pmatrix}
R \\
R
\end{pmatrix}_{R}$$

$$\begin{pmatrix}
Ar O \\
OAr
\end{pmatrix}_{OAr}$$

$$\begin{pmatrix}
O \\
OAr
\end{pmatrix}_{OAr}$$

(上記式において、Rは同一または相異なる水素原子ま たは炭素数 1~5のアルキル基をあらわす。Arは同一 または相異なる芳香族基、Yは直接結合、アルキレン 基、フェニレン基、-S-、-SO2-、または-CO - を表す。Arは同一または相異なるフェニル基または 有機基で置換されたフェニル基を意味する。k、mはそ れぞれ0以上2以下の整数であり、k+mは0以上2以 下の整数である。nはO以上の整数である。)なかでも IVの構造を有するものが好ましく使用される。

学構造の異なるものや、分子量の異なるものの混合物で あってもよい。リン酸エステル化合物の添加量は、難燃 性、半田耐熱性および耐湿信頼性の観点から、エポキシ 樹脂組成物中における無機充填剤を除く成分に対して、 リン酸エステル化合物のリン原子の量が、下の量として 好ましくは0.01重量%、さらに0.1重量%、上の 量として10重量%さらに5重量%の順に好ましい。

【0036】またリン酸エステル化合物の分子量として は、300以上、さらに500以上のものを、リン酸エ

性、半田耐熱性の観点から好ましい。また本発明の組成 物では、組成物中に3価のリン原子を有するリン酸エス テルを配合して、組成物中での酸化によって5価のリン 原子を有するリン酸エステルとしたものでも同様の効果 が得られる。リン酸エステル化合物は、エステル結合が 加水分解し、さらに他のリン原子と結合し、P-O-P 結合をもつもの、すなわち縮合物であってもよい。

【0037】半導体装置が、より高い耐湿安定性を要求 される場合には、本発明の樹脂組成物にイオン捕捉剤が 【0035】本発明におけるリン酸エステル化合物は化 40 配合されるのが好ましい。イオン捕捉剤とはイオンを捕 捉する機能を有するものであり、そのようなものとして はイオン交換体、ハイドロタルサイト系化合物が例示さ れる。

> 【0038】イオン交換体とは、イオンの交換を行う機 能を有する物質を意味し、例えばイオンを有する溶液が 接触すると、物質中のイオンが溶液中に出る一方、溶液 のイオンが物質の中に取り込まれる機能を有するものを いう。

【0039】ハイドロタルサイト系化合物とは、一般的 ステル中に50重量%以上もつものであることが、耐湿 50 には下記式(VII)で示される不定比化合物複合金属化

合物、およびその焼成により水およびA"-基が一部また *【0040】 は全部脱離した化合物を言う。 【化12】

> $[M^{2+}_{1-\alpha} M^{3+}_{\alpha} (OH)_{2}]^{\alpha+} [A^{n-}_{\alpha/n} \cdot mH_{2} O]^{\alpha-}$ (VII)

ここでM²⁺は金属の2価の正イオンを意味し、マグネシ ウム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅の2価の 正イオンが例示される。

【0041】またM³+は金属の3価の正イオンを意味 し、アルミ、鉄、クロム、コバルト、インジウムの3価 「の正イオンが例示される。

【0042】またA"-はn価の負イオンを意味し、OH $\overline{}$ 、 Br $\overline{}$ 、 F $\overline{}$ 、 C1 $\overline{}$ 、 NO $_3$ $\overline{}$ 、 , CO $_3$ $\overline{}$ 、 , $SO4^-$ 、 Fe (CN) $_6$ $^3-$ CHCOO C H 4 (○H) C○○ 、酒石酸イオン、シュウ酸イオン、 サリチル酸イオンなどが例示される。

【0043】 αは、イオン捕捉性を有する化学構造とす るために、通常はOを超えO.33以下である。mはO 以上の数を示す。

【0044】通常M²⁺としてマグネシウムイオン、M³⁺ としてアルミニウムイオン、A"-としてCO₃ 2-のもの 20 が使用できる。

【0045】ハイドロタルサイト系化合物の好ましい具 体例としては、(VII) 式で表されるものとして、Mg 4.5 Al₂ (OH)₁₃CO₃ · 3. 5H₂ O, Mg_{4.5} Al₂ (OH)₁₃CO₃ 、Mg, Al_{1.5} (OH)₁₃C $O_3 \cdot 3.5 H_2 O_3 Mg_3 Al_{1.5} (OH)_{13} C$ O_3 , Mg_6 Al_2 $(OH)_{16}CO_3$ $\cdot 4H_2$ O_3 Mg。Al₂ (OH)₁₆CO₃、また(VI)式で表されるもの から水および負イオンが脱離したものとしてMgo.65A $l_{0.35}O_{1.175}$, $Mg_{0.7}Al_{0.3}O_{1.15}$, $Mg_{0.75}A$ 30 lo.2 5 O1.125 、Mgo.8 Alo.2 O1.1 などが挙げ られる。水および負イオンが脱離したハイドロタルサイ ト系化合物は、(VII)で表されるハイドロタルサイト 系化合物を、400~900℃、好ましくは500~7 ○○℃で焼成処理することにより得ることができる。

【0046】本発明において、ハイドロタルサイト系化 合物を配合する場合、その添加量は組成物全体の 0.0 1~5重量%、好ましくは0.02~3重量%、特に好 ましくは0.03~1重量%である。少ないと添加によ る効果がなく、多いと半田耐熱性が低下する傾向があ る。

【0047】また、本発明のエポキシ樹脂組成物には、 シランカップリング剤が配合されるのが好ましい。シラ ンカップリング剤としては、アルコキシ基、ハロゲン原 子、アミノ基などの加水分解性基および有機基がケイ素 原子に直結したもの、ならびにその部分加水分解縮合物 が一般的に用いられる。加水分解性の基としてはアルコ キシ基、なかでも、メトキシ基、エトキシ基が好ましく 用いられる。有機基としては、炭化水素基や窒素原子、 酸素原子、ハロゲン原子、硫黄原子などによって置換さ 50 ℃のミキシングロールを用いて5分間加熱混練した後、

れた炭化水素基が使用することができる。特にアミノ基 を有する有機基を有するシランカップリング剤、エポキ シ基を有する有機基を有するシランカップリングが好ま しく用いられ、さらに2級アミノ基を有するシランカッ プリング剤が好ましい。

12

10 【0048】本発明のエポキシ樹脂組成物には、上記し たもの以外に、カーボンブラック、酸化鉄などの着色 剤、シリコーンゴム、オレフィン系共重合体、変性ニト リルゴム、変性ポリブタジエンゴム、変性シリコーンオ イルなどのエラストマー、ポリエチレンなどの熱可塑性 樹脂、長鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸の金属塩、長鎖脂肪酸の エステル、長鎖脂肪酸のアミド、パラフィンワックスな どの離型剤および有機過酸化物などの架橋剤を任意に添 加することができる。

【0049】本発明においては、ハロゲン化エポキシ樹 脂などのハロゲン化合物などの難燃剤、三酸化アンチモ ンなどの各種難燃助剤も配合できるが、半導体装置とし ての信頼性を低下させる傾向があることから、ハロゲン 原子およびアンチモン原子それぞれが、樹脂組成物に対 して0.2重量%以下、0.1重量%以下、さらに0. 01重量%以下、さらには実質的に配合されていないと とが好ましい。

【0050】また本発明のエボキシ樹脂組成物において はエポキシ樹脂の硬化後の状態での酸素指数が42%以 上であることが、難燃性、高温信頼性、成形性の観点か ら好ましい。

【0051】本発明のエポキシ樹脂組成物は、上記の原 料を混合した後、溶融混練することが好ましく、たとえ ばバンバリーミキサー、ニーダー、ロール、単軸もしく は二軸の押出機およびコニーダーなどの公知の混練方法 を用いて溶融混練することにより製造される。溶融温度 としては60~130℃の範囲が好ましい。さらに、本 発明のエポキシ樹脂組成物によって半導体素子を封止し 半導体装置となる。

【0052】ことで半導体装置とは、トランジスタやダ 40 イオード、抵抗、コンデンサーなどを半導体素子や基板 の上に集積し配線して作った電子回路(集積回路)のと とを指し、広くは本発明のエポキシ樹脂組成物により封 止した電子部品を指す。

[0053]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す る。なお、実施例中の%は重量部を示す。

【0054】実施例 比較例

表1に示した成分を、表2に示した組成比でミキサーに よりドライブレンドした。これを、ロール表面温度90

冷却・粉砕して半導体封止用エポキシ樹脂組成物を製造 した。

【0055】この樹脂組成物を用い、低圧トランスファ 一成形法により175℃、キュアータイム2分間の条件 で成形し、さらに180℃,5時間の条件でポストキュ アーして下記の物性測定法により各樹脂組成物の物性を 評価した。

【0056】半田耐熱性:表面にA1配線を蒸着した模 擬半導体を搭載した、チップサイズ12×12mmの1 60pinQFP(クアッドフラットパッケージ)を2 10 酸素指数(%)=[酸素]/([酸素]+[窒素]) 0個成形し、85℃/85%RTで所定時間加湿後、最 高温度245℃のIRリフロー炉で加熱処理し、外部ク ラックの発生数を調べた。

【0057】吸水率:半田耐熱性試験に用いるのと同じ 160pinQFPを85℃/85%RTで所定時間加 湿後、樹脂組成物の吸水率を測定した。

【0058】高温信頼性:模擬半導体素子を搭載した1

14

6pinDIP (デュアルインラインパッケージ)を用 い、200℃での高温信頼性を評価し累積故障率63% になる時間を求め高温特性寿命とした。

【0059】難燃性試験:5"×1/2"×1/16" の燃焼試験片を上記と同様に成形・ポストキュアーし、 UL94規格に従い難燃性を評価した。

【0060】酸素指数:5"×1/2"×1/8"の試 験片を成形・ポストキュアーし、JIS K7201に 従い燃焼限界点における各ガスの体積濃度を求めた。

【0061】PKG充填性(パッケージ充填性):半田 耐熱試験に用いる160pinQFPを成形後に目視お よび顕微鏡を用いて観察し、未充填・ボイドの有無を調 べた。

【0062】結果を表3に示す。

[0063]

【表1】

名称		内容	添加量(重量部)
エポキシ 樹脂	I	エポキシ当量 2 0 0 のオルソクレソールノボラック樹脂	*
	II	4, 4' - ビス(2,3-エポキシブロポキシ) - 3, 3', 5, 5' -テトラメチルビフェニル	*
硬化剂	I	水酸基当量107のフェノールノボラック樹脂	*
	II	下記式Eで表わされるフェノール化合物	*
無機質充填	剤	平均粒子径10μmの非晶性シリカ	*
難燃剤	I	下記式Aであらわされるリン酸エステル化合物	*
	II	下記式Bであらわされるリン酸エステル化合物	*
	III	下記式Cであらわされるリン酸エステル化合物	*
	IV	下記式Dであらわされるリン酸エステル化合物	*
	v	トリフェニルホスフェート	*
	٧I	エポキシ当量400 、臭業合有量50重量% ビスフェノールA型樹脂	*
難燃助剤	•	三酸化アンチモン	*
硬化促進剤		トリフェニルホスフィン	0.1
シランカップ リンタ	' 剤	N-フェニルアミノプロピルトリメトキシシラン	1. 0
着色剤		カーボンプラック	0. 2
龍型剤	······································	カルナパワックス	0.3
ካ ፈት'	化合物	協和化学工業製 DHT4H	*

* 配合量は表2に配載。

(A)
$$CH_3$$
 CH_3 $CH_$

(C)
$$CH_3$$
 CH_3 $CH_$

(式(E) においてRはメチル基、nは0.8) 【表2】 [0064] 40

19 **表 2**

エポキシ樹 硬化剂 充填剤 難 燃剤 難燃 ハイト・ロタル 脂添加量 添加量 添加量 助剤 51 h (重量部) (重量部) (重量部) 添加 添加量 系化合物 量(重 類 量都) (重 . I II I II (笛量部) 量部) 実施例1 0.0 7.9 0.0 7.0 80.0 3.5 0 Ţ 0 実施例2 0.0 0.0 6.0 4.9 85.0 2.5 Ī 0 0 実施例3 2. 6 2.6 0.0 4.7 87.0 1.5 0 0 Ī 実施例 4 0.0 6.1 1.9 1.9 87.0 1.5 0 0 実施例5 5. 5 0.0 4.4 0.0 87.0 1.5 0 0 実施例6 0.0 5. 0 0.0 4.0 89.0 I 0.4 0 0 実施例7 0.0 **5.** 5 0.0 4.4 87.0 1.5 I 0 0 実施例8 0.0 **5.** 5 4.4 87.0 0.0 1.5 II 0 0 実施例9 0.0 5.5 0.0 4.4 87.0 III 1.5 0 0 実施例10 0.0 5.5 0.0 4.4 87.0 1.5 IT 0 0 実施例11 0.0 **5.** 5 0.0 | 4.4 87.0 1 1.5 O 0.1 実施例12 0.0 4. 3 0.0 3.8 90.0 I 0.3 Q 0 実施例13 0.0 5.5 0.0 4.4 87.0 Y 1.5 Q 0 比較例1 0.0 9.0 0.0 7. B 78.0 I 3.5 0 0 比較例2 0.0 6.3 0.0 5.1 87.0 0 0 比较例3 0.0 6.8 0.0 5.6 85.0 VΙ 0.5 0.5 0

[0065]

比較例 4

0.0

6.3

0.0

5.1

87.0

0

0.1

表 3.

	酸素 指数 (%)	難燃性 (UL94)	高温 信頼性 (h)	P K G 充填性	半田耐熱性	吸水率(%)
実施例1	4 5	V — 0	400	良好	0/20	0.28
実施例2	4 4	V - 0	500	良好	0/20	0. 21
実施例3	4 7	v - 0	>500	良好	0/20	0.19
実施例4	48	V - 0	>500	良好	0/20	0.19
実施例 5	5 0	v - 0	>500	良好	0/20	0.15
実施例 6	5 2	V - 0	>500	良好	0/20	0.13
実施例?	5 0	V - 0	>500	良好	0/20	0.15
実施例8	5 0	v – o	>500	良好	0/20	0.15
実施例9	5 0	V - 0	>500	良好	0/20	0.15
実施例10	4 9	V - 0	>500	良好	0/20	0.17
実施例11	5 0	v - 0	>500	良好	0/20	0.16
実施例12	5 5	v - o	>500	良好	0/20	0.12
実施例13	5 0	v - 0	400	良好	5/20	0.16
比較例1	4 1	V - 1	200	良好	10/20	0.31
比較例2	4 0	v – out	400	ボイド	0/20	0.13
比較例3	4 9	v – o	130	ボイド	2/20	0.25
比較例4	3 9	v — опт	400	ボイド	0/20	0.13

【0066】表3に見られるように、本発明のエポキシ 40 【表4】 樹脂組成物は、難燃性、半田耐熱性、高温信頼性、パッ ケージ充填性に優れている。

【0067】さらに上記の組成物の一部を選び、耐湿信頼性試験(PCBT特性寿命測定)を行った。その測定方法は、模擬素子を搭載した16pin, DIP(デュアルインラインパッケージ)を用い、140℃、85%RH、DC20V印加下での断線の有無を評価し、累積故障(断線)率が63%になる時間を求めるものである。【0068】結果を表4に示す。

[0069]

表 4

PCBT特性寿命 (h)
8 Q
250
100
2 5 0

【0070】表4から、リン酸エステル化合物を配合し*

* た場合、ハイドロタルサイト系化合物を配合することによって、リン酸エステル化合物を配合しない場合に比べて著しく、耐湿信頼性向上効果を見ることができる。 【0071】

24

【発明の効果】本発明のエポキシ樹脂組成物によれば、従来使用されていた難燃剤、難燃助剤を必ずしも用いることなく、難燃性が付与され、さらに流動性・充填性に代表される成形性に優れる。さらに封止に用いて、半導体装置とした場合に、著しく高温信頼性に優れ、また低の水であることから半田耐熱性に優れる。またハイドロタルサイトをさらに配合することによって耐湿信頼性が著しく向上する。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 23/31